

# Suporte De Wafer De Ptfе Para Semicondutores 8 Polegadas Cassete De Gravação Resistente A Hf Para Limpeza Úmida

Número do item: PL-CP82



## introdução

Otimize o processamento de semicondutores com este suporte de wafer premium de PTFE de 8 polegadas projetado para aplicações de limpeza úmida de alta pureza e gravação com HF. Nossas cassetes de fluoropolímero de grau industrial garantem máxima resistência química, durabilidade superior e manuseio preciso para ambientes sensíveis de produção em sala limpa.

[Saiba mais](#)

Aplicação	Descrição	Benefício Principal
Gravação de Wafer de Silício	Manuseio de wafers durante a remoção de camadas sacrificiais usando químicas à base de HF.	Resistência completa ao ataque ácido garante maior durabilidade do suporte.
Processo de Limpeza RCA	Suporte a wafers através de múltiplas etapas de remoção de contaminantes orgânicos e iônicos.	A pureza do material evita a recontaminação de superfícies limpas.
Pós-Limpeza CMP	Transporte de wafers por escovas de limpeza e banhos químicos após o planoamento.	A baixa liberação de partículas mantém contagens de defeitos extremamente baixas.
Remoção de Fotoresiste	Uso de solventes agressivos para remover revestimentos sensíveis à luz após a litografia.	A inércia química evita a degradação do material em banhos de solvente.
Fabricação de Células Solares	Suporte ao processamento de substratos em larga escala em ambientes de alto teor de ácido para células PV.	A durabilidade na produção de alto volume reduz os custos de substituição.
Fabricação de MEMS	Gerenciamento de sistemas microeletromecânicos delicados durante etapas complexas de liberação úmida.	O alinhamento preciso das ranhuras evita danos mecânicos às estruturas.
Amostragem Analítica	Uso do suporte como porta-substrato para análise de traços de metal de alta pureza.	Níveis de fundo ultra-baixos garantem resultados laboratoriais precisos.

Categoria de Característica	Detalhes Técnicos para PL-CP82
Identificação do Produto	Suporte de Wafer Personalizado Série PL-CP82
Material Principal	PTFE Virgem de Alta Pureza (Politetrafluoretileno)
Compatibilidade com Tamanho de Wafer	8 polegadas padrão (200mm) / Diâmetros totalmente personalizáveis
Tipo de Configuração	Wafer único (individual) ou Multi-ranhura disponível
Método de Fabricação	Usinagem CNC de Precisão 100% (Sem resíduos de moldagem)
Faixa de Temperatura	-200°C a +260°C (-328°F a +500°F)
Compatibilidade Química	Universal (HF, HCl, H2SO4, KOH, Acetona, etc.)
Rugosidade de Superfície	Personalizável com base em requisitos específicos de sala limpa
Passo / Profundidade de Ranhura	Adaptado aos parâmetros de processo específicos do cliente

Aplicação	Descrição	Benefício Principal
Categoria de Característica	Detalhes Técnicos para PL-CP82	
<b>Alça / Interface</b>	Pontos de captura robótica personalizados ou opções de pegada manual	
<b>Precisão Dimensional</b>	Controle de tolerância de alta precisão conforme padrões industriais	